SUMMARY. An intercalation of thallium into monophosphate tungsten bronze  $(PO_2)_4(WO_3)_{14}$  at interaction with molten salts has been studied. The monophosphate tungsten bronze of composition  $Tl_x(PO_2)_4(WO_3)_{14}$  ( $0.6 \le x \le 1.53$ ) has been synthesised. Composition of the crystals was determined by roentgen-spectral microanalysis. Unit cell lattice parameters were determined basing on powder X-ray diffraction data. It has been determined that temperatures of resistivity anomalies at 82—174 and 200—278 K depend on thallium concentration. The valent states of the thallium atoms in monophosphate tungsten bronzes crystals have been defined using roentgen-photoelectron spectroscopy.

- 1. Roussel P., Perez O., Labbe Ph. // Acta Crystallographica B. -2001. -57. - P. 603-632.
- 2. Roussel P., Labbe Ph., Groult D. // Ibid. -2000. -56. -P. 377-390.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

- 3. Ottolenghi A., Pouget J.-P. // J. Phys. (I) France. -1996. -6. -P. 1059—1083.
- Roussel P., Groult D., Hess C. et al. // J. Phys. Condensed Matter. -1997. -9. -P. 7081—7089.
- Roussel P., Groult D., Maignan A., Labbe Ph. // Chem. Mater. -1999. -11. -P. 2049—2056.
- Wang E., Greenblatt M. // J. Solid State Chem. -1989.
   -81. -P. 173—178.
- 7. Roussel P., Masset A. C., Domenges B. et al. // Ibid. -1998. -139. -P. 362-372.
- 8. Gruehn R., Glaum R. // Angew. Chem. Int. Ed. -2000. -112. -P. 706-745.
- Domenges B., Roussel P., Labbe Ph., Groult D. // J. Solid State Chem. -1996. -127. -P. 302—307.
- Нефедов В.И. Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений. -М.: Химия, 1984.
- 11. McGuire G. E., Schweitzer G. K., Carlson T. A. // Inorg. Chem. -1973. -12, № 10. -P. 2450—2453.

Надійшла 27.02.2004

#### УДК 546.541.12.017+54.04:681

### Д.М. Фреїк, В.М. Бойчук, Л.Й. Межиловська

# ЗАРЯДОВИЙ СТАН ГАЛІЮ І МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ АТОМНИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ РЬТе: Ga

З позиції спонтанної дисоціації домішки галію  $2Ga^{2+} \rightarrow Ga^{1+} + Ga^{3+}$  у телуриді свинцю запропоновано кристалоквазіхімічні рівняння, які описують утворення атомних дефектів. Показано, що на початкових етапах легування реалізується механізм заміщення галієм вакансій свинцю  $Ga_{Pb}^{3+}$ . Глибоке легування обумовлює утворення міжвузлового галію  $Ga_i^{3+}$  у тетрапорожнинах підгратки телуру з наступним утворенням нової фази  $Ga_2Te_3$ . Стабілізація рівня Фермі і, відповідно, концентрації електронів пов'язана з утворенням  $Ga_{Pb}^{1+}$  на обидвох етапах легування.

Телурид свинцю є базовим матеріалом для створення термоелектричних перетворювачів енергії, фотоприймальних пристроїв, а також випромінювальних структур середнього і далекого інфрачервоного діапазону оптичного спектру [1, 2]. РbTе кристалізується у гратці типу NaCl (a=6.452 Å) і характеризується наявністю двосторонньої області гомогенності [2]. Аналіз його властивостей, а також розрахунок хвильових функцій валентних електронів дає можливість зробити висновок про переважання йонного хімічного зв'язку в сполуці (Pb<sup>2+</sup>Te<sup>2–</sup>) [3].

Антиструктурою телуриду свинцю є галеніт  $V_{Pb}^{\prime\prime\prime}V_{Te}^{**}$ , де  $V_{Pb}^{\prime\prime\prime}$  і  $V_{Te}^{**}$  — двократнозаряджені негативна і позитивна вакансії свинцю і телуру, а  $^{\prime\prime\prime}$  і \*\* — негативний і позитивний заряди

відповідно. Вакансія свинцю  $V_{Pb}^{/\prime}$  є акцепторним центром з надлишком негативного заряду, рівному двом зарядам електрона, а вакансія телуру  $V_{Te}^{**}$  — ефективним донорним центром.

В основу кристалоквазіхімічного аналізу дефектної підсистеми покладено суперпозицію кристалоквазіхімічних кластерів основної матриці і легуючого елемента, утворених на основі антиструктури цих сполук [4]. Кристалоквазі-хімічний запис *n*-PbTe (надстехіометрія свинцю) буде наступним:

$$V_{Pb}^{//} V_{Te}^{**} + Pb^{o} \rightarrow V_{Pb}^{//} V_{Te}^{**} + (Pb^{**} + 2e') \rightarrow$$
  
$$\rightarrow (V_{Pb}^{//} + Pb^{**}) V_{Te}^{**} + 2e' \rightarrow Pb_{Pb} V_{Te}^{**} + 2e'. (1)$$

Тут <sup>о</sup> — нульовий заряд, Рb<sub>Pb</sub> — свинець у вузлі

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. ЖУРН. 2005. Т. 71, № 6

<sup>©</sup> Д.М. Фреїк, В.М. Бойчук, Л.Й. Межиловська, 2005

кристалічної гратки, Рb<sup>о</sup> — нейтральний атом свинцю.

Суперпозиція кластера (1) із квазіхімічною формулою основної матриці  $Pb_{Pb}^{x}Te_{Te}^{x}$  описується згідно з рівнянням:

$$(1 - \alpha) Pb_{Pb}^{x} Te_{Te}^{x} + \alpha (Pb_{Pb}^{x} V_{Te}^{**} + 2e') \rightarrow$$
  

$$\rightarrow (Pb_{1-\alpha}^{x} Pb_{\alpha}^{x})_{Pb} (Te_{1-\alpha}^{x} V_{\alpha}^{**})_{Te} + 2\alpha e' \rightarrow$$
  

$$\rightarrow Pb_{Pb}^{x} (Te_{1-\alpha}^{x} V_{\alpha}^{**})_{Te} + 2\alpha e', \qquad (2)$$

де α — мольні долі легуючої компоненти, <sup>x</sup> — нейтральний стан атома.

Згідно з (2) стає очевидним, що надлишок свинцю призводить до утворення додаткових вакансій телуру ( $(V_{\alpha}^{**})_{Te}$ ) і збільшується концентрація вільних електронів ( $2\alpha e'$ ), які й спричиняють *n*-тип провідності матеріалу [2].

Кристалоквазіхімічне представлення нестехіометричного *p*-PbTe (надлишок телуру в границях області гомогенності) описується такими представленнями:

$$V_{Pb}^{/\prime}V_{Te}^{**} + Te^{o} \rightarrow V_{Pb}^{\prime\prime}V_{Te}^{**} + (Te^{\prime\prime} + 2h^{*}) \rightarrow$$
  

$$\rightarrow V_{Pb}^{\prime\prime}(V_{Te}^{**} + Te^{\prime\prime}) + 2h^{*} \rightarrow V_{Pb}^{\prime\prime}Te_{Te}^{x} + 2h^{*},$$
  

$$(1 - \alpha)Pb_{Pb}^{x}Te_{Te}^{x} + \alpha(V_{Pb}^{\prime\prime}Te_{Te}^{x} + 2h^{*}) \rightarrow$$
  

$$\rightarrow (Pb_{1-\alpha}V_{\alpha}^{\prime\prime})PbTe_{Te}^{x} + 2\alpha h^{*},$$
 (3)

тут  $Te_{Te}^{x}$  — телур у вузлах кристалічної гратки;  $h^{*}$  — концентрація дірок.

Діркова провідність телуриду свинцю пов'язана із вакансіями у катіонній підгратці  $(V_{\alpha}^{/\prime})_{Pb}$ та зростанням вільних дірок.

Легування РbTe відкриває нові можливості не тільки для модифікування концентрації носіїв заряду, але і для спостереження ефектів, що пов'язані із утворенням глибоких рівнів як на фоні дозволених енергій, так і всередині забороненої зони [4, 5]. Не дивлячись на достатньо детальні дослідження процесів легування телуриду свинцю галієм [6—14], результати яких послідовно відображаються в ряді оглядів [3, 5], кристалохімічні аспекти цієї проблеми залишаються поза увагою. Так, зокрема, нерозв'язаною є задача про природу дефектів та можливе розташування їх у кристалічній гратці основної матриці.

Мета даної роботи — аналіз дефектної підсистеми з позицій кристалоквазіхімії та розгляд фізико-хімічних властивостей кристалів PbTe : Ga.

При легуванні елементами III групи періодичної таблиці (In, Ga, Tl) у телуриді свинцю має місце утворення глибоких рівнів і стабілізація рівня Фермі [5]. Для всіх перерахованих елементів спостерігається насичення на залежностях  $n, p(N_i),$  тобто ефект хімічної стабілізації положення рівня Фермі. На залежностях  $n, p (N_{G2})$ для PbTe : Ga виявлено як мінімум дві ділянки насичення. Перша ділянка спостерігається відразу після інверсії типу провідності з р на п. Вона відповідає концентрації електронів, близької до власних значень (n<10<sup>13</sup> см<sup>-3</sup> при температурі Т=77 К), і високим опорам зразків. Концентрації N<sub>Ga</sub> у зразках, що відповідають цій ділянці насичення, залежать від методу синтезу і за різними даними змінюються в межах від  $10^{19}$  до  $10^{20}$  см<sup>-3</sup> (від 0.66 до 6.6 % ат.). Друга ділянка насичення спостерігається при більш ви-соких концентраціях галію:  $N_{\rm Ga} > 10^{20}$  см<sup>-3</sup> (бі-льше 6.6 % ат.). Їй відповідає концентрація електронів  $n=2\cdot10^{18}$  см<sup>-3</sup>. У металокерамічних електронів  $n=2.10^{-2}$  см<sup>-1</sup>. у металокерамічних зразках була виявлена стабілізація концентрації електронів на рівні  $n=6.10^{19}$  см<sup>-3</sup> при концент-рації  $n=5.10^{20}$  см<sup>-3</sup>,  $N_{Ga}=5.10^{20}$  см<sup>-3</sup> (33 % ат.) [5]. Однак у літературі відзначено [3, 5], що в умовах стабілізації концентрації електронів у n-Pb-Te(Ga) дотримується умова n<<N<sub>Ga</sub>.

Вперше ідея про перемінну валентність домішок третьої групи Періодичної системи елементів описана в огляді [3]. Коротко суть ідеї полягає в наступному. Зовнішня оболонка атомів елементів ІІІ групи має конфігурацію  $s^2p^1$ (табл. 1). Однак у сполуках ці елементи можуть виявляти валентність від 1 до 3, тобто у зв'язок може вступити або один електрон з *p*-стану (конфігурація  $s^2p^1$ , валентність +1), або два (конфігурація  $s^1p^2$ , валентність +2), або всі три (конфі-

Таблиця 1 Електронна структура та радіуси Рb, Te i Ga [8]

	r, Å		
Структура	Pb	Ga	Те
	$4f^{14}5d^{10}6s^26p^2$	$3d^{10}4s^24p^1$	$4d^{10}5s^25p^4$
Атомна	1.81	1.30	1.42
Ковалентна	1.47	1.26	1.36
Йонна	1.26 (2+)	0.62 (3+)	2.11 (2–)
Октаедрична	1.62	1.16	1.64
Тетраедрична	1.46	_	1.34

гурація  $s^{o}p^{3}$ , валентність +3), причому найбільш нестійкими є сполуки з атомом III групи, що знаходиться в двовалентному стані. Це зрозуміло, оскільки в *s*-оболонці залишається один неспарений (парамагнітний) електрон. Тобто галій у PbTe може знаходитися у трьох зарядових станах Ga<sup>1+</sup>, Ga<sup>2+</sup> і Ga<sup>3+</sup>. При цьому якщо Ga<sup>2+</sup> буде нейтральним дефектом (Ga<sup>+2</sup>  $\rightarrow D^{o}$ ) у відношенні до катіонної підгратки Pb<sup>2+</sup> у PbTe, то два інші — зарядженими (Ga<sup>+1</sup>  $\rightarrow D^{-}$ — акцептор; Ga<sup>+3</sup>  $\rightarrow D^{+}$  — донор). Спонтанна дисоціація відповідає реакції типу  $D^{o} \rightarrow D^{-}+D^{+}$  [3]:

$$2Ga^{2+} \rightarrow Ga^{+} + Ga^{3+}$$
. (4)

З урахуванням спонтанної дисоціації галію, згідно з (4), процеси легування РbТе можна описати кристалоквазіхімічними рівняннями. Так, для механізму заповнення галієм вакансій свинцю легуючий кластер буде мати вигляд:

$$V_{Pb}^{\prime\prime}V_{Te}^{**} + Ga^{o} \rightarrow V_{Pb}^{\prime\prime}V_{Te}^{**} + (Ga_{\frac{1}{2}}^{*}Ga_{\frac{1}{2}}^{***} + 2e^{\prime}) \rightarrow$$
$$\rightarrow Ga_{\frac{1}{2}Pb}^{\prime}Ga_{\frac{1}{2}Pb}^{*}V_{Te}^{**} + 2e^{\prime}.$$
(5)

Тоді кристалоквазіхімічне рівняння для легування галієм кристалів *p*-PbTe згідно з (3) і (5) запишеться як:

$$(1-x)\{[Pb_{1-\alpha}^{x}V_{\alpha}^{\prime\prime}]_{Pb}Te_{Te}^{x} + 2\alpha h^{*}\} + x\{Ga_{\frac{1}{2}Pb}^{\prime}Ga_{\frac{1}{2}Pb}^{*}V_{Te}^{**} + 2e^{\prime} \rightarrow \\ \rightarrow [Pb_{(1-\alpha)(1-x)}^{\prime\prime}V_{\alpha(1-x)}^{\prime\prime}Ga_{\frac{1}{2}x}^{\prime}Ga_{\frac{1}{2}x}^{*}]_{Pb}[Te_{1-x}^{x}V_{x}^{**}]_{Te} + 2\alpha(1-x)h^{*} + 2xe^{\prime}.$$
(6)

Тут має місце заміщення вакансій свинцю галієм, збільшення кількості вакансій телуру і, як наслідок, зменшення концентрації дірок і зростання концентрації електронів.

Для *n*-PbTe згідно з (2) і (5) отримаємо:

$$(1-x)\{Pb_{Pb}^{x}[Te_{1-\alpha}^{x}V_{\alpha}^{**}]_{Te} + 2\alpha e'\} + x\{Ga_{\frac{1}{2}Pb}^{\prime}Ga_{\frac{1}{2}Pb}^{*}V_{Te}^{**} + 2e'\} \rightarrow$$
  

$$\rightarrow [Pb_{1-x}^{x}Ga_{\frac{1}{2}x}^{\prime}Ga_{\frac{1}{2}x}^{*}]_{Pb}[Te_{(1-\alpha)(1-x)}^{x}V_{\alpha(1-x)}^{**}V_{x}^{**}]_{Te} + 2(\alpha(1-x)+x)e',$$
(7)

при цьому галій добудовує підгратку свинцю із донорним ефектом.

Крім описаних механізмів, розглянемо також вкорінення галію Ga<sup>3+</sup> у тетрапорожнини оточення телуру кристалічної гратки РbTe. Легуючий кластер буде мати вигляд:

$$V_{Pb}^{''}V_{Te}^{**} + Ga^{o} \rightarrow V_{Pb}^{''}V_{Te}^{**} + (Ga_{\frac{1}{2}}^{*}Ga_{\frac{1}{2}}^{***} + 2e^{\prime}) \rightarrow V_{\frac{1}{2}Pb}^{''}Ga_{\frac{1}{2}Pb}^{'}V_{Te}^{**}(Ga_{\frac{1}{2}}^{***})_{i} + 2e^{\prime}.$$
 (8)

Для *p*-типу PbTe цей механізм опишеться наступним рівнянням:

$$(1-x)\{[Pb_{1-\alpha}^{x}V_{\alpha}^{\prime\prime}]_{Pb}Te_{Te}^{x} + 2\alpha h^{*}\} + x\{V_{\frac{1}{2}Pb}^{\prime\prime}Ga_{\frac{1}{2}Pb}^{\prime}V_{Te}^{**}(Ga_{\frac{1}{2}}^{***})_{i} + 2e^{\prime}\} \rightarrow$$

$$\rightarrow [Pb_{(1-\alpha)(1-x)}^{\prime\prime}V_{\alpha(1-x)+\frac{1}{2}x}^{\prime\prime}Ga_{\frac{1}{2}x}^{\prime}]_{Pb}[Te_{1-x}^{x}V_{x}^{**}]_{Te} \cdot (Ga_{\frac{1}{2}}^{***})_{i} + 2\alpha(1-x)h^{*} + 2xe^{\prime} \rightarrow$$

$$\rightarrow [Pb_{(1-\alpha)(1-x)}^{x}V_{\alpha(1-x)+\frac{1}{2}x}^{\prime\prime}Ga_{\frac{1}{2}x}^{\prime}]_{Pb} \cdot (Te_{1-x-\frac{3}{4}x}^{**}V_{x}^{**}]_{Te}(Ga_{\frac{1}{2}}^{x}Te_{\frac{3}{4}}^{*})_{x} + [2\alpha(1-x) +$$

$$+ \frac{3}{2}x]h^{*} + 2xe^{\prime} .$$
(9)

Для *п*-типу телуриду свинцю будемо мати:

$$(1-x)\{[Pb_{Pb}^{x}[Te_{1-\alpha}^{x}V_{\alpha}^{**}]_{Te} + 2\alpha e'\} + x[V_{\frac{1}{2}Pb}^{''}Ga_{\frac{1}{2}Pb}^{'}V_{Te}^{**}(Ga_{\frac{1}{2}}^{***})_{i} + 2e'\} \rightarrow$$
  

$$\rightarrow [Pb_{(1-x)}^{x}V_{\frac{1}{2}x}^{''}Ga_{\frac{1}{2}x}^{'}]_{Pb}[Te_{(1-\alpha)(1-x)}^{x}V_{\alpha(1-x)+x}^{**}]_{Te} \cdot (Ga_{\frac{1}{2}}^{***})_{i} + 2(\alpha(1-x) + x)e' \rightarrow$$
  

$$\rightarrow [Pb_{(1-x)}^{x}V_{\frac{1}{2}x}^{''}Ga_{\frac{1}{2}x}^{'}]_{Pb}[Te_{(1-\alpha)(1-x)-\frac{1}{4}x}^{x}V_{\alpha(1-x)+x}^{**}]_{Te} \cdot (Ga_{\frac{1}{2}}^{x}Te_{\frac{3}{4}}^{x})_{x} + 2(\alpha(1-x) + x)e' + \frac{3}{2}xh^{*}. (10)$$

З рівнянь (9) і (10) видно, що як для діркового, так і для електронного РbTe при вкоріненні галію у тетраедричні порожнини оточення телуру проявляється його донорна дія, тобто відбувається зростання вільних електронів (2xe'), а при утворенні окремої фази Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> — стабілізація концентрації електронів за рахунок утворення додаткових вільних дірок ( $\frac{3}{2}xh^*$ ). Експериментально встановлене зменшення параметра гратки із збільшенням вмісту Ga [12], співставлення йонних радіусів свинцю і галію (табл. 1) і радіусів октаедричних і тетраедричних порожнин в оточенні телуру (табл. 2), а та-

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. ЖУРН. 2005. Т. 71, № 6

Таблиця 2

Радіуси тетраедричних ( $r_{\rm TII}$ ) і октаедричних ( $r_{\rm OII}$ ) порожнин для щільних упаковок елементів Pb і Te в різному стані для структури PbTe

гп, А	<i>г</i> <sub>ОП,</sub> Å
1.37	1.81
1.43	1.87
0.68	1.12
0.98	1.42
1.32	1.76
1.53	1.97
	1.37 1.43 0.68 0.98 1.32 1.53

кож зростання концентрації електронів на початкових етапах легування [5] вказують на переважання механізму заповнення галієм вакансій свинцю для *p*-PbTe (6) або добудови катіонної підгратки — *n*-PbTe (7). При цьому переважаючу роль відіграють йони  $Ga_{Pb}^{3+}$ , які при "низьких" значеннях рівня Фермі (слабке легування) дають у *p*-зону три електрони (стан  $s^{o}p^{3}$ ), тоді як свинець — два. Іншими словами, у цьому випадку галій поводиться як однозарядний донор  $Ga_{Pb}^{3+}$ .

При зміні концентрації легуючої домішки буде змінюватися і механізм входження галію у твердому розчині Pb—Ga—Te. Так, із збільшенням числа донорів Ga<sup>3+</sup><sub>Pb</sub> буде рости і рівень Фермі, що зробить перехід домішки в тривалентний стан невигідним [7]. Частина електронів повинна залишитися на *s*-оболонці домішки, а в такій конфігурації в зонах буде присутній лише один *p*-електрон (стан  $s^2 p^1$ ). Таким чином, при досягненні деякого критичного значення рівня Фермі донорна дія буде компенсуватися однозарядними акцепторами Ga<sup>+</sup><sub>Pb</sub>. Це явище приводить до стабілізації (піннінгу) рівня Фермі при збільшенні концентрації домішки галію.

Важливо відмітити, що реально процес переходу донора в акцептор повинен обов'язково йти через проміжний стан, оскільки в природі немає полів, що дозволяють робити відразу двоелектронні переходи. Таким проміжним станом є двовалентний стан домішки галію  $(s^1p^2)$ , що може реалізуватися тільки як збуджений. З цієї причини в системі виникає потенціальний бар'єр, що при досить низьких температурах приводить до явища довгочасових релаксацій нерівноважних носіїв [7].

Наступне зростання концентрації елект-

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. ЖУРН. 2005. Т. 71, № 6

ронів при подальшому легуванні галієм [5] можна пояснити механізмами, описаними рівняннями (8), (9), (10). Тут має місце часткове заміщення галієм свинцю  $Ga_{pb}^+$ , а також вкорінення галію  $Ga_i^{3+}$  у тетраедричні порожнини оточен-ня телуру, які незайняті. Донорним центром бу-де вкорінений галій  $(Ga_{1/2x})_i$ , оскільки його валентні електрони вільні, так як не утворюють хімічних зв'язків з Те. З метою усунення механічних напружень кристалічної гратки міжвузловий галій буде намагатися утворити окремий комплекс з виділенням нової фази, найімовірніше Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> [13], згідно з рівняннями (9), (10). Це буде причиною спостережуваного на експерименті другого плато на залежності концентрації носіїв заряду від вмісту галію [5]. Тут необхідно зауважити, що нова фаза скупчується на міжзернових границях, тобто буде створювати певний енергетичний бар'єр для носіїв заряду, що і обумовлює спостережувані на експерименті [3] активаційний механізм провідності і суттєве зменшення рухливості носіїв заряду.

Зауважимо, що при виділенні фази Ga<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> утворюється надлишок свинцю, який буде та-



Кристалічна модель атомної дефектної підсистеми PbTe—Ga: • — катіони  $Pb_{Pb}^{2+}$ ; • — аніони  $Te_{Te}^{2-}$ ; октаедричні порожнини в оточенні Pb (1), Te (2); тетраедричні порожнини в оточенні Pb (3), Te (4);  $\Delta$  — вакансія свинцю  $V_{pb}^{"}$ , центр октаедричної порожнини в оточенні телуру; V — вакансія телуру  $V_{Te}^{**}$ , центр октаедричної порожнини в оточенні свинцю; • —  $Ga_{pb}^{+}$ ; • —  $Ga_{7b}^{2+}$ ; • —  $Ga_i^{3+}$ ; • — вкорінений свинець  $Pb_i^{2+}$ ; • —  $\phi$ aза  $Ga_2Te_3$ .

кож стимудювати перехід  $Ga_i^{3+}$  у  $Ga_{Pb}^+$  [13], що сприятиме стабілізації концентрації електронів.

У кінцевому результаті атомна дефектна підсистема кристалів PbTe:Ga може бути представлена схемою, зображеною на рисунку.

РЕЗЮМЕ. С позиции спонтанной диссоциации примеси галлия  $2Ga^{2+} \rightarrow Ga^{1+} + Ga^{3+}$  в теллуриде свинца предложены кристаллоквазихимические уравнения, описывающие образование атомных дефектов. Показано, что на начальных этапах легирования реализуется механизм замещения галлием вакансий свинца  $Ga_{pb}^{3+}$ . Глубокое легирование обусловливает образование межузлового галлия  $Ga_i^{3+}$  в тетраполостях подрешетки теллура с последующим образованием новой фазы  $Ga_2Te_3$ . Стабилизация уровня Ферми и, соответственно, концентрации электронов связана с образованием  $Ga_{pb}^{2+}$  на двух этапах легирования.

SUMMARY. The crystal-quasichemical equation, that describe the formation of atomic defects from position of spontaneous dissociation of admixture of gallium  $2Ga^{2+} \rightarrow Ga^{1+} + Ga^{3+}$  at the lead tellurides are offered. It is shown, that on the initial stages of alloying the substitution mechanism by gallium of vacancies of the lead  $Ga_{pb}^{3+}$  will be realized. The deep alloying stipulates formation of interlattice of gallium  $Ga_i^{3+}$  in tetraspaces sublattice of tellurium with a next formation of a new phase  $Ga_2Te_3$ . The stabilization of Fermi level and, accordingly the concentration of the both stages of alloying.

Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ

- 1. Абрикосов Н.Х., Шелимова Л.Е. Полупроводниковые материалы на основе А<sup>IV</sup>В<sup>VI</sup>. -М.: Наука, 1969.
- Фреїк Д.М., Прокопів В.В., Галущак М.О. та ін. Кристалохімія і термодинаміка атомних дефектів у сполуках А<sup>IV</sup>В<sup>VI</sup>. -Івано-Франківськ: Плай, 1999.
- 3. Драбкин И.А., Мойжес Б.Я. // Физика и техника полупроводников. -1981. -15, № 4. -С. 625—648.
- 4. Лісняк С.С., Фреїк Д.М., Галущак М.О. та ін. // Фізика і хімія тв. тіла. -2000. -1, № 1. -С. 131—133.
- 5. Волков Б.А., Рябова Л.И, Хохлов Д.Р. // Успехи физ. наук. -2002. -172, № 8. -С. 875—906.
- 6. Белоконь С.А., Верещагина Л.Н., Иванчик И.И. и др. // Физика и техника полупроводников. -1973. -7, № 5. -С. 928—932.
- 7. Волков Б.А. // Успехи физ. наук. -2003. -173, № 9. -С. 1013—1015.
- Бушмарина Г.С., Грузинов Б.Ф., Драбкин И.А. и *др.* // Физика и техника полупроводников. -1977. -11, № 10. -С. 1874—1881.
- 9. *Ерофеев Р.С., Овечкина В.Н.* // Неорган. материалы. -1978. -**14**, № 2. -С. 243—246.
- 10. Бушмарина Г.С., Грузинов Б.Ф., Дедегкаев Т.Т. и др. // Там же. -1980. -16, № 12. -С. 2136—2138.
- 11. Рогачева Е.И., Ефимова Б.А., Лаптев С.А. // Там же. -1983. -19, № 2. -С. 204—206.
- 12. Лакеенков В.М., Тетеркин В.В., Сизов Ф.Ф. и др. // Там же. -1984. -20, № 5. -С. 757—759.
- 13. Бушмарина Г.С., Грузинов Б.Ф., Драбкин И.А. и др. // Там же. -1987. -23, № 2. -С. 222—227.
- 14. Скипетров Е.П. // Физика и техника полупроводников. -1995. -29, № 8. -С. 1416—1423.
- 15. Семилетов С.А. // Кристаллография. -1976. -**21**, № 4. -С. 752—758.

Надійшла 03.03.2004

### УДК 544.18.143

## В.В. Соловйов, Л.О. Черненко

# ВПЛИВ КАТІОННОГО ОТОЧЕННЯ НА РЕАКЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ ЕАЧ У РОЗПЛАВАХ, ЩО МІСТЯТЬ ВОЛЬФРАМАТИ

На основі результатів порівняльного аналізу неемпіричних розрахунків енергій НВМО і активаційних бар'єрів відновлення "ізольованого" аніона WO<sub>4</sub><sup>2-</sup> і його катіонізованих форм встановлено, що вплив катіонного оточення на елементарний акт переносу заряду приводить до активації вольфрамат-йона у приелектродному шарі в реакціях електровідновлення.

В роботі [1] на основі результатів електрохімічних досліджень оксіаніонів вольфраму та молібдену на фоні хлоридних розплавів з катіонами різного питомого заряду був запропонований феноменологічний механізм утворення

© В.В. Соловйов, Л.О. Черненко, 2005

електрохімічно активних часток (ЕАЧ) за схемою:

$$nM^{m+} + EO_4^{2-} \rightarrow \{M_n^{m+}[EO_4]^{2-}\}^{(mn-2)+}$$
 (1)

з наступним їх двох- і шестиелектронним відновленням:

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. ЖУРН. 2005. Т. 71, № 6